

## Průběh obhajoby diplomové práce:

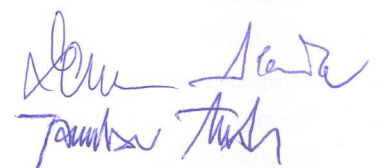
Vztah rutilové a tetragonální struktury  
Závislost tloušťky vrstvy na teplotě substrátu  
Optimální tloušťka termochromatické vrstvy  
Velí říditelnos členu na produkci  $VO_2$   
Charakteristika TiPMG  
Závislost tloušťky vrstvy na době depozice

Klasifikace:

velmi dobře

Datum obhajoby:

19. června 2015

.....  
podpis zkoušejícího